

## F3: Grundläggande CMOS teknologi

- **Målsättning**

- Ge en introduktion till teknologin som bygger upp integrerade kretsar i CMOS och en förståelse till teknologins begränsningar

- **Innehåll**

- Tillverkningsprocessen
  - komponenter i CMOS
  - designregler

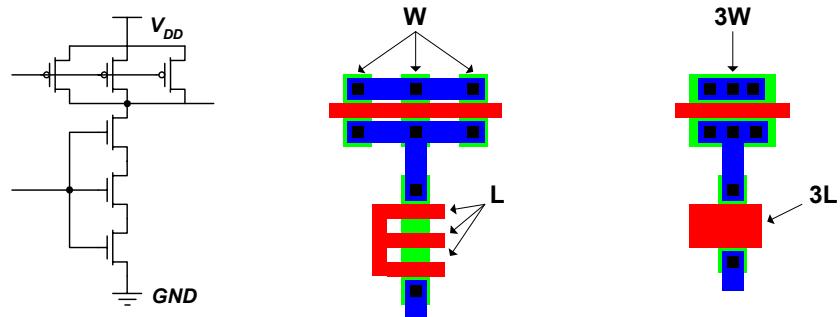
1 ( 1 8 )

## Introduktion

- **Den fysiska representationen av en CMOS krets (layout) består av:**
  - kombinationer av lager som bygger upp en komponent (t.ex transistorer och dioder)
  - ledningslager
  - kontakter mellan olika lager
- **Teknologin sätter begränsningar på layouten**
  - enskilda komponenter
  - förhållandet mellan komponenter
  - elektriska kopplingar mellan komponenter
- **Designregler bestämmer**
  - hur små transistorerna får vara
  - minsta bredd på ledare
  - minsta avstånd mellan komponenter

2 ( 1 8 )

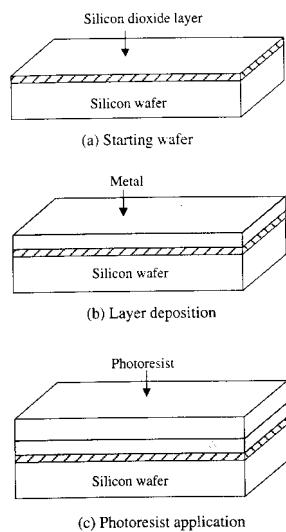
## Exempel på layout



3 ( 18 )

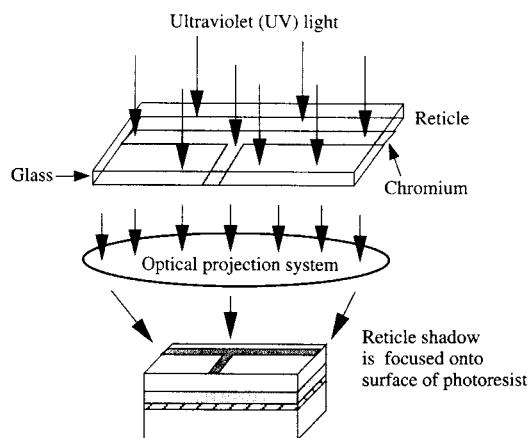
## Fotolitografisk process, första stegen

- Exempel: skapa en metalledning på ytan av kiselskivan



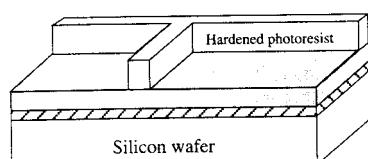
4 ( 18 )

## Fotolitografisk process, exponering

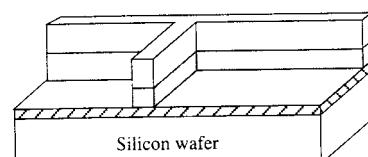


5 ( 1 8 )

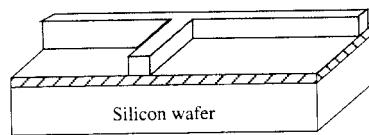
## Fotolitografisk process, etsning



(a) After development



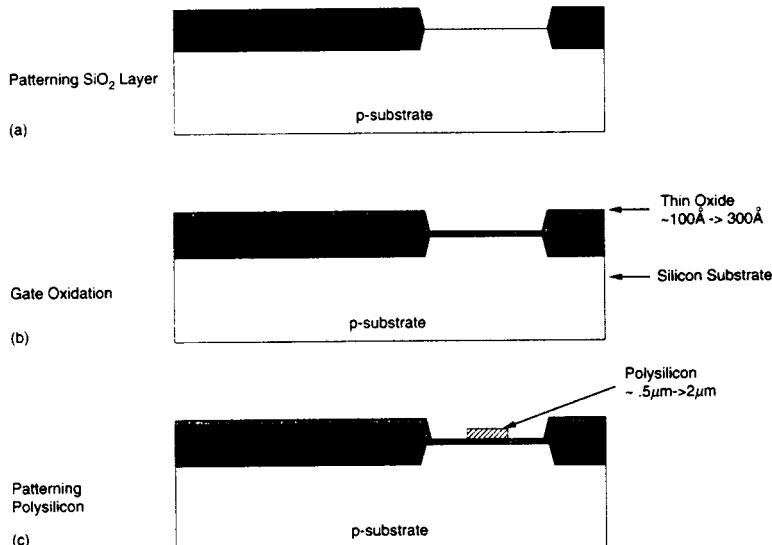
(b) After etching



(c) Final pattern

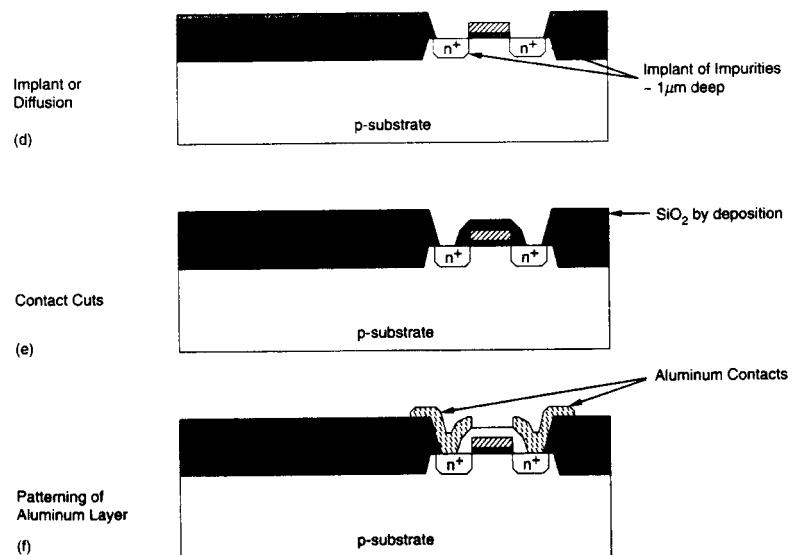
6 ( 1 8 )

## Uppbyggnad av en nMOS



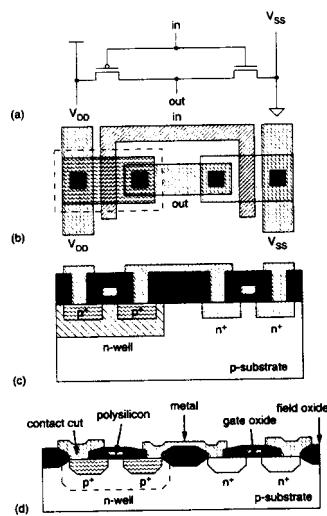
7 ( 18 )

## Uppbyggnad av en nMOS



8 ( 18 )

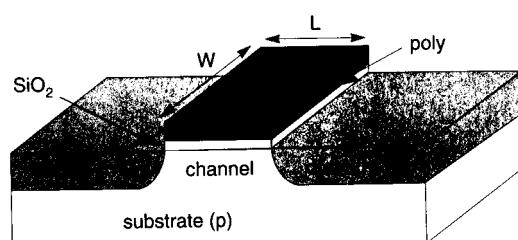
## CMOS inverterare i genomskärning



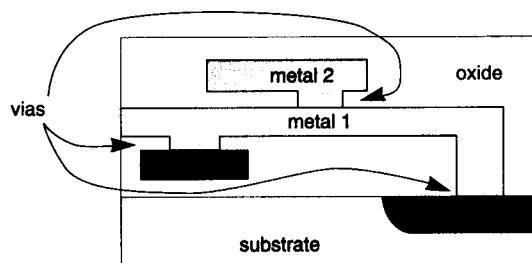
9 ( 18 )

## Konstruktionselement i CMOS

- MOS transistor



- Ledningar och via-kontakter



10 ( 18 )

## Fysikalisk bakgrund till designregler

- Designregler för en process baseras bl. a på följande:

- Begränsningar i litografin
- Processflödets fysiska begränsningar
- Elektriska egenskaper för de färdiga strukturerna

11 (18)

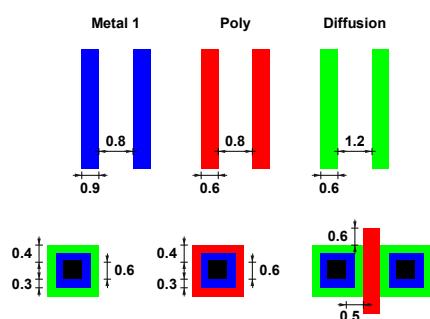
## Fyra exempel på designregler

- Minsta linjebredd

- Hör samman med litografins upplösningsförmåga
- Minsta linjebredd (uttryckt i  $\mu\text{m}$ ) är den minsta bredden för en ledare som kan skapas tillförlitligt på ett lager *utan risk* för att det blir brott på ledaren.

- Minsta avstånd

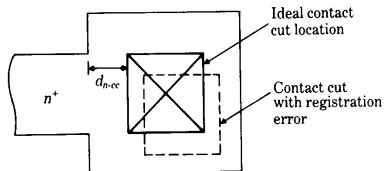
- Hör samman med litografins upplösningsförmåga
- Regeln gäller minsta avståndet mellan två geometrier på samma lager
- Förhindrar att två ledare kortsluts vid för små avstånd



12 (18)

## Fyra exempel på designregler

- Minsta avstånd mellan geometrier på olika lager
  - En komponent (t.ex MOS-transistor, kontakt)
  - Passningen mellan lagren måste ligga inom vissa toleranser för att få en fungerande komponent
  - Exempel: minsta överlapp för "kontakt till n+"

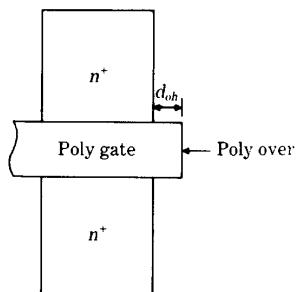


- Regeln anger minsta tillåtna överlappningen av n+ kring kontaktöppningen. Detta tillåter att visst fel i passningen mellan kontaktlagret och n+ lagret.
- $d_{n-cc}$  anger minsta tillåtna överlappet.

13 (18)

## Fyra exempel på designregler

- POLY-gate överhäng
  - En poly-gate måste ha ett visst överhäng för att inte source och drain ska kortslutas
  - Detta kommer från att poly läggs på före n+/p+ implanten görs. Bildandet av source och drain beror på poly-masken i SIG-processer (Silicon Gate).



14 (18)

## Uppsättning med designregler

- Det finns två metoder att ange design regler
  - $\lambda$ -baserat
  - $\mu$ -baserat
- $\lambda$ -baserade regler
  - är en uppsättning med förenklade regler som medger skalning till olika processer
  - är generella och kan användas till många olika tillverkares processer
  - medger inte maximal packningstäthet (inbyggda marginaler)
  - Allmänt känt och sammansatt av MOSIS
- $\mu$ -baserade regler
  - En lista med minsta geometriska regler som gäller för en specifik process
  - Består av ett tiotal sidor, svårt att lära sig utantill
  - Medger maximal packningstäthet
  - Ges ut av halvledartillverkaren

15 ( 18 )

## Skalbara regler

- $\lambda$ -baserade regler anges i en variabel  $\lambda$
- Exempel
  - $\lambda=1$  motsvarar  $2\mu\text{m}$  process
  - $\lambda=0.6$  motsvarar  $1.2\mu\text{m}$  process
  - $\lambda=0.4$  motsvarar  $0.8\mu\text{m}$  process

16 ( 18 )

## Balans: densitet - utbyte

- **Design regler är en balans mellan**
  - storleken på kretsen (vilken packningstäthet man kan uppnå)
  - utbytet i tillverkningsprocessen
- **Kommentar**
  - En layout som bryter mot design reglerna kan fortfarande fungera, och vice versa.
  - Brott mot design reglerna minskar sannolikheten för att en krets ska fungera (utbytet blir sämre)
  - Design regler kan ses som en kommunikation mellan processingenjör och konstruktör

17 ( 18 )

## Summering

- $\lambda$ -baserade regler är inte tillräckligt för teknologier med hög prestanda
- Design regler kontrolleras av datorverktyg, design rule checkers (DRC)
- Fördelaktigt att låta datorverktyg automatisk generera layout enligt reglerna

18 ( 18 )